

**NEWS RELEASE**

**酸化ガリウムパワー半導体開発に向けてノベルクリスタルテクノロジー社に出資  
省エネ性に優れたパワー半導体の研究開発を加速し脱炭素社会の実現に貢献**

三菱電機株式会社は、次世代パワー半導体ウエハの一つとして注目される酸化ガリウムウエハを開発・製造・販売する株式会社ノベルクリスタルテクノロジー（以下、ノベルクリスタルテクノロジー社）へ出資しました。当社は今後、酸化ガリウムパワー半導体の研究開発を加速し、省エネ性に優れたパワー半導体を社会に広く普及させることで、脱炭素社会の実現に貢献します。

**出資のねらい**

当社は脱炭素社会の実現を目指し、ケイ素（Si）や炭化ケイ素（SiC、以下 SiC）を用いたパワー半導体製品を実用化し、パワーエレクトロニクス機器の省エネ化に貢献しています。

近年、パワー半導体のウエハとして SiC や窒化ガリウム（GaN）の開発が進みつつありますが、さらに高耐電圧かつ低電力損失のパワー半導体製品の実現に向けた次世代ウエハとして酸化ガリウム（Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>）が期待されています。

ノベルクリスタルテクノロジー社は、世界でもいち早くパワー半導体用酸化ガリウムウエハの開発・製造・販売に着手した実績を持ち、当社の酸化ガリウムパワー半導体製品の開発に必要なウエハ製造の技術を持つ、酸化ガリウムウエハのリーディングカンパニーです。

当社は今後、長年培ってきた低電力損失で信頼性の高いパワー半導体の製品設計や製造技術と、ノベルクリスタルテクノロジー社の酸化ガリウムウエハの製造技術を融合させることで、省エネ性に優れた酸化ガリウムを用いたパワー半導体の研究開発を加速します。

**ノベルクリスタルテクノロジー社の概要**

会社名	株式会社ノベルクリスタルテクノロジー
代表者	倉又 朗人
所在地	埼玉県狭山市広瀬台 2-3-1
設立日	2015年6月30日
資本金	1億6,292万円(2022年5月12日現在)
事業内容	酸化ガリウムエピタキシャル膜付基板の製造販売 単結晶およびその応用製品の製造販売 半導体およびその応用製品の製造販売
URL	<a href="https://www.novelcrystal.co.jp/">https://www.novelcrystal.co.jp/</a>

**お問い合わせ先**

<報道関係からのお問い合わせ先>

三菱電機株式会社 広報部  
〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号  
TEL 03-3218-2332 FAX 03-3218-2431

<お客様からのお問い合わせ先>

三菱電機株式会社 半導体・デバイス第一事業部 パワーデバイス営業部  
〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号  
URL <https://www.MitsubishiElectric.co.jp/semiconductors/contact/>